

BULETINUL

ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA

FIZICA ȘI TEHNICA

ИЗВЕСТИЯ

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ФИЗИКА И ТЕХНИКА

REVISTĂ TEORETICO-ȘTIINȚIFICĂ
FONDATĂ ÎN OCTOMBRIE 1989
APARE DE TREI ORI PE AN

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ОСНОВАН В ОКТЯБРЕ 1989 ГОДА
ВЫХОДИТ ТРИ РАЗА В ГОД.



1 (7)

1992

Chișinău
„Știință”
Кишинев

Computer

CHINESE

<i>Енаки Н.А., Препеллица О.Б.</i> Коллективное двухфотонное взаимодействие с сжатым электромагнитным полем	3
<i>Синявский Э.П.</i> Потенциал примесных центров нулевого радиуса в двумерных системах	12
<i>Симонов Ю.А., Дворкин А.А., Малиновский Т.И., Губина Е.Е., Лампека Р.Д., Фрицкий И.О.</i> Кристаллическая структура оксида пирувиламида	16
<i>Боярская Ю.С., Головин Ю.И., Кац М.С., Тюрин А.И., Шибков А.А.</i> Динамика микроиндентирования и сопутствующие электрические процессы в монокристаллах LiF	20
<i>Хаджи П.И., Киселева Е.С., Пасечник О.Ф.</i> Нелинейные поверхностные направляемые электромагнитные волны в размерно-ограниченных средах при учете взаимодействия когерентных экситонов	25

Tavliya

Ермуратский В.В. Общий вид и свойства моделей старения конденсаторов	32
Бурлаку М.И., Розенкранц Р.Я. О структуре регионального банка экологических показателей энергопредприятий	34
Ермуратский В.В. Модели электрического старения конденсаторов	40
Гурьянов Г.В., Андреева Л.Н. Перспективы развития электрохимического старения деталей машин	42

Науки о Земле

<i>Билинкис Г.М., Пушняк А.Н., Сатиш С.Т. Перспективы использования диамидов Приднестровья для очистки сточных вод</i>	<i>47</i>
<i>Подражанский В.А. Фильтрационные свойства грунтовых водоносных горизонтов Молдовы</i>	<i>54</i>

Краткие сообщения

卷之三

Симонов Ю.А., Попа И.А., Мазук М.Д., Шафранский В.Н., Малиновский Т.И.	
Строение 2-сульфамиламиодицирамидина	58
Симонов Ю.А., Мазук М.Д., Шафранский В.Н., Попа И.А., Дворкин А.А.	
Кристаллическая структура ү-пиразин-2-карбоксамида	61
Дедю В.И., Збравков В.И., Канцер В.Г., Киоссе Г.А., Лукаш В.Ф., Соколовский А.И. Влияние технологического режима ВЧ-магнетронного распыления на сверхпроводящие свойства тонких цепочек $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$	64
Палистрант М.Е., Кагалб М.Г. Низкотемпературные термодинамические свойства двухзонных сверхпроводников и $2\Delta_i/T_c$ при нефононном механизме сверхпроводимости	70
Скимбов А.А. Обобщение экспериментальных данных по теплоотдаче при кипении смесей в электрическом поле	80
Скимбов А.А. Теплообмен при кипении недогретых смесей в электрическом поле	84
Радаудан С.И., Урсаки В.В., Терлецкий А.И. Образование глубоких уровней в $\text{p}-\text{InP}$ при электронном облучении	85

Техника

Болога А.М. Параметры электростатических распылителей жидкости	88
Болога М.К., Коровкин В.И., Савин И.К. Эквиарельная деформация грани- цы раздела и сопряженные вопросы равновесия	94
Агунов М.В., Агунов А.В. Реактивная способность периодического электромаг- нитного поля в величине	97

Олянский Ю.И., Возк В.М., Бодгевич О.Л. Результаты изучения реологических свойств сармат-мертийских глин	100
Олянский Ю.И., Бодгевич О.Л., Возк В.М. Карта просадочности лессовых толщ междууречья Прут—Илья	106
Рефераты	108

Из рис.1 видно, что с ростом напряженности поля и увеличением теплового потока до $1,4 \cdot 10^5$ Вт/м² интенсивность теплоотдачи больше при умеренных тепловых потоках ($q \approx 3,0 \cdot 10^4$ Вт/м²) и относительное увеличение $\alpha_e/\alpha_0 = 1,75$, а с ростом q оно стремится к 1. В режиме критических тепловых потоков ($P = 1,0 \cdot 10^5$ Па) наблюдается увеличение относительных критических тепловых потоков.

В зависимости $\alpha = f(E)$ при $q = 2,25 \cdot 10^4 \text{ Вт}/\text{м}^2$ коэффициент теплоотдачи увеличивается монотонно с ростом концентрации низкокипящего компонента (гексан) и напряженности электрического поля (рис. 2).

Выполненные измерения показали, что в отличие от кипения насыщенной жидкости в недогретой смеси под воздействием электрического поля между α и произведением f_{ad} существует обратная связь.

Кипение недогретой жидкости характеризуется большими критическими тепловыми потоками по сравнению с насыщенной. При этом максимальный тепловой поток растет линейно с недогревом жидкости и напряженностью поля.

Силовое воздействие поля на ЭГД-течение и вторжение холодных слоев жидкости в пределы двухфазного слоя при кипении смесей может привести к частичному или полному вырождению пузырькообразования на теплоотдающей поверхности. В данном случае теплоизлучающая жидкость осуществляется электроконвекцией.

Результаты могут быть использованы в инженерных расчетах при проектировании аппаратуры, работающей в теплонаагруженном режиме.

Изменения

1. Болога М.К., Гросу Ф.П., Кожухир И.А. Электропроводность и теплообмен. Кишинев, 1977.
2. Скимбов А.А. Автореф. дис. ...канд. техн. наук. Киев, 1979.

Bezüge

Se comunică rezultatele obținute în cadrul cercetării experimentale a degajării convective de căldură, în timpul fierberii întărită a unui cimp electric a amestecurilor subincălzite, cind coeficientul de convectie a căldurii și curentul critic de căldură se măresc semnificativ, datorită procedeului de subincălzire, variației concentrației amestecului, neomogeneității chimice și termice, neuniformitatea tensiunii cimpului electric și a altor mărimi fizice.

Sugars 37

The results of investigation of convective heat exchange at underheated mixtures boiling in electric field are given. Coefficient of convective heat exchange and critical heat flux increased significantly for account of underheating of medium, temperature, field strength and other physical quantities.

Печатана 3.10.01

С.И.Радащан, В.В.Урсаки, А.И.Терлецкий *

ОБРАЗОВАНИЕ ГЛУБОКИХ УРОВНЕЙ В p -InP ПРИ ЭЛЕКТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

Фосфид индия наряду с арсенидом галлия и твердыми растворами на их основе является перспективным материалом твердотельной электроники. Большое влияние на электрические и оптические свойства InP оказывают

* © Радунан С.И., Узунов А.В., Терентьев А.



глубокие локализованные состояния, связанные с различными дефектами. Одним из широко применяемых методов изучения дефектообразования в InP является обработка материала высокозергетичными электронами [1, 2]. В данной работе изучено образование дефектов в p-InP при облучении электронами и их изохронный отжиг. Методами исследования служили фотолюминесценция (ФЛ) и нестационарная спектроскопия глубоких уровней (НЕСГУ) [3].

В качестве исходного материала использовался p-InP, легированный цинком, с концентрацией дырок $p = 2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$ и подвижностью $\mu = 130 \text{ см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$ при $T = 300\text{K}$. Образцы подвергались облучению электронами с энергией 3,4МэВ дозой $2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$ и дальнейшему изохронному отжигу в атмосфере водорода при температурах $50\text{...}400^\circ\text{C}$ в течение 15 мин. Для емкостных измерений на поверхности пластин с ориентацией (100) были изготовлены барьеры Шоттки. Спектры ФЛ измерялись при температуре 77К с использованием излучения аргонового лазера ($0,488\text{...}0,514 \mu\text{м}$) в качестве источника возбуждения. Регистрация производилась в режиме синхронного детектирования на частоте 1 кГц, спектральное разрешение было не хуже 10 мэВ.

На рис.1 показаны спектры ФЛ исходного образца p-InP, облученного электронами при дозе $2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$ с последующим изохронным отжигом. На рисунке приведен спектр в длинноволновой области. Отметим, что в краевой области картина ФЛ аналогична той, которая наблюдалась в p-InP [4], т.е. облучение электронами приводит к появлению двух полос ФЛ при энергиях 1,392 и 1,305 эВ, связанных с двумя зарядовыми состояниями антиструктурного дефекта InP. Как видно из рис.1, в исходном материале выделяется полоса ФЛ с максимумом при 1,08 эВ. Облучение электронами приводит к преобладанию в спектре ФЛ полосы с максимумом при 0,99 эВ. При изохронном отжиге до температуры 300К происходит относительный рост интенсивности полосы ФЛ при 0,86 эВ, в результате чего эта полоса становится преобладающей.

На рис.2 приведены спектры НЕСГУ p-InP, облученного электронами с дозой $2 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$ с последующим отжигом при температурах до 400°C . Электронное облучение приводит к образованию в значительной концентрации двух дырочных ловушек, обозначаемых H1 и H2. На вставке к рис.2 показана температурная зависимость скорости эмиссии носителей для ловушек H1 и H2. В результате анализа этих зависимостей определены энергии активации уровней E_t и сечения захвата σ . Получены следующие значения: $E_{t1} = 0,38 \text{ эВ}$, $\sigma_1 = 1 \cdot 10^{-15} \text{ см}^{-2}$; $E_{t2} = 0,54 \text{ эВ}$, $\sigma_2 = 6 \cdot 10^{-15} \text{ см}^{-2}$. Отметим, что E_t определяет энергетическое положение уровня относительно потолка валентной зоны E_v . Из рис.2 видно, что при изохронном отжиге концентрация ловушки H1 резко падает начиная с самых низких температур отжига, тогда как концентрация ловушки H2 сначала растет с температурой отжига до 300°C , а затем уменьшается. На

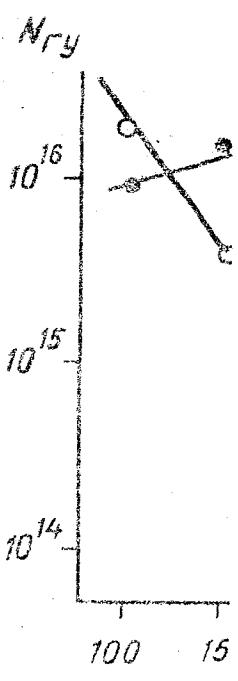


Рис. 3. Кривы

рис.3 приведены кривы ГУ с параметрами, результате электронно эти уровни связаны с с состав которых входят

Результаты наших и ФЛ при 0,86 эВ и дыро ФЛ и ловушка H2 вед близкие кривые отжига: уменьшением интенсиви эВ дает приблизительно полоса ФЛ при 0,86 эВ и Предварительное исслед дефекта в процессе ком

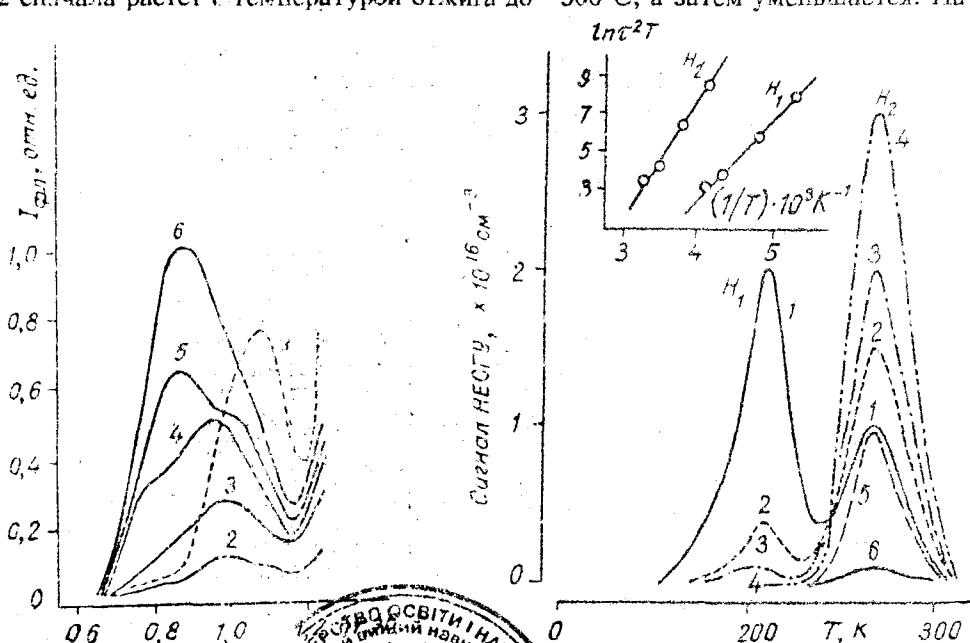


Рис. 1. Спектры ФЛ при 77К: исходных кристаллов p-InP и после облучения электронами с энергией 4МэВ дозой 2 (2-6) с энергией 4МэВ дозой 2 $\cdot 10^{17} \text{ см}^{-2}$ и отжига в атмосфере H_2 при $T, ^\circ\text{C}$: 2—100, 3—150, 4—200, 5—250, 6—300. На вставке показана температурная зависимость скорости эмиссии для ловушек H1 и H2

Prin metoda de fotoluminescență se procesează pentru a genera și să se stabilească că prelucrarea cu și două trape profunde a golurilor purtăre analogică a benzii FL și dovedă că legătura lor cu unul

The defect generation and an photooluminescence (PL) and that electron irradiation leads to traps H1 and H2 with the activation energy of 0,86 eV PL band intensity annealing indicates to their con-

Одним является в работе и и их (ФЛ) и

ый цинк (В·с) 3,4 МэВ одорода единий на Погодки. зия арт. Регистр 1 кГц.

ченного гом. На краевой [4], т.е. нергиях турного ядра ФЛ танию в жиге до оси ФЛ

жами с Электрии двух оказана 1 и H2, уровней В, $\sigma_1 =$ еделяется $1/E_v$. Из подает овушки тся. На

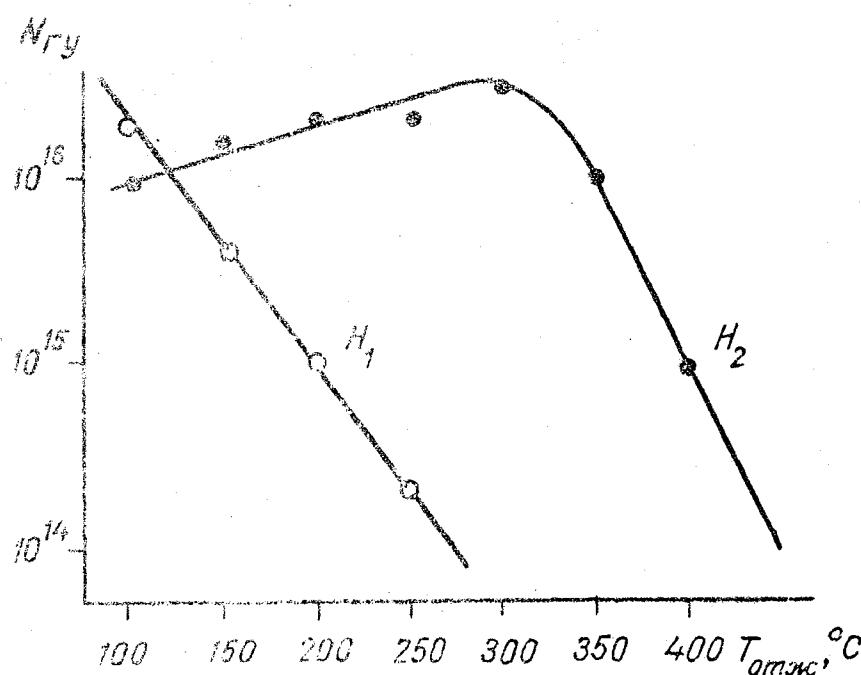


Рис. 3. Кривые изохронного отжига для двух дырочных ловушек H1 и H2 в p-InP

на рис. 3 приведены кривые отжига для двух дырочных ловушек H1 и H2 в p-InP. ГУ с параметрами, близкими к H1 и H2, были обнаружены ранее в p-InP в результате электронного облучения [1,5]. В этих работах предполагается, что эти уровни связаны с собственными дефектами решетки, либо с комплексами, в состав которых входят собственные дефекты и примеси.

Результаты наших исследований указывают на возможную связь между полосой ФЛ при 0,86 эВ и дырочной ловушкой H2 (0,54 эВ). Можно заметить, что полоса ФЛ и ловушка H2 ведут себя одинаково при электронном облучении и имеют близкие кривые отжига: рост их интенсивности до температур 300°C с дальнейшим уменьшением интенсивности. Учитывая, кроме того, что сумма энергий 0,86 и 0,54 эВ дает приблизительно ширину запрещенной зоны InP, можно предположить, что полоса ФЛ при 0,86 эВ и дырочная ловушка H2 связаны с одним и тем же дефектом. Предварительное исследование электрических параметров говорит об участии этого дефекта в процессе компенсации проводимости кристаллов фосфида индия.

Литература

1. Suski J., Sibille A., Bourgois J. // Solid St. Commun. 1984. 49. №9. P.875-878.
2. Pyshnaya N.B., Tigranyan I.M., Ursachi V.V., Ursu V.D., Aliev I.M., Halilov H.A. // Cryst. Res. Technol. 1991. 26. №6. P.704-708.
3. Lang D.V. // J. Appl. Phys. 1974. 45. №7. P.3023.
4. Корнилов Ф.П., Разумаш С.И., Соболев Н.А., Тигиняну И.М., Урсаки В.В., Кудрявцева Е.А. // ФТГ. 1989. 23. Вып. 9. С.1581--1583.
5. Levinson M., Teicka M., Bonner W.A. // J. Electron. Mater. 1983. 12. №2. P.423—429.

Rezumat

Prin metoda de fotoluminescentă (FL) și spectroscopia nivelelor profunde prin capacitate (DLTS) este studiat procesul de generare și anivălare a defectelor în p-InP la prelucrare cu electroni și tratament termic. S-a stabilit, că prelucrarea cu electroni duce la formarea a două benzi FL cu maximele la 0,86 și 0,99 eV și două trape profunde a gălăgilor cu energia de activare termică 0,38 (H1) și 0,54 eV (H2). S-a observat purtare analogică a benzii FL 0,86 eV și trapelor profunde H2 la prelucrarea cu electroni și termică, ce dă dovadă de legătura lor cu unul și același defect.

The defect generation and annealing process in electron irradiated p-InP have been investigated by photoluminescence (FL) and deep level transient spectroscopy (DLTS) methods. It has been established that electron irradiation leads to the formation of two FL bands at 0,86 and 0,99 eV, as well as of two hole traps H1 and H2 with the activation energy equal to 0,38 and 0,54 eV respectively. The similar behaviour of 0,86 eV FL band intensity and trap concentration under the sample electron irradiation and thermal annealing indicates to their connection with the same center.

Поступила 28.10.91

